

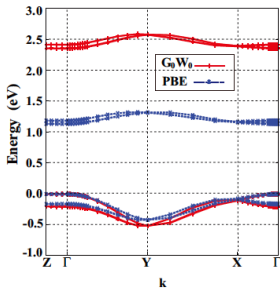


1. 研究背景・目的

有機エレクトロニクス材料物質の基礎電子物性の理解

- バンドギャップ・バンド分散の精密予測

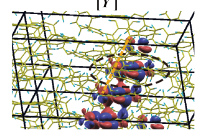
ルブレ単結晶のバンド計算
(GW近似: GW space-time プログラム)



S. Y., Y. Morikawa, and A. Schindlmayr, Phys. Rev. B **88**, 115438 (2013)

有効正孔質量(m_h^*/m_e)

m/m_e	$[\Gamma-Y]$	$[\Gamma-X]$
DFT	1.00	2.15
GW	0.90	1.65
Exp.	0.65 ± 0.1	1.9 ± 0.3

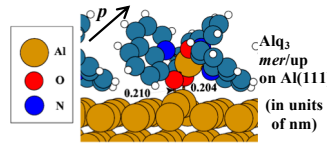


- 有機層と電極金属の界面

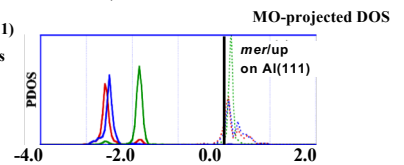
電荷 (正孔・電子) の電極からの注入障壁の形成要因
- 界面での電荷移動、化学結合
- 電子密度分布の再構成

H. Ishii et al., Adv. Mater. **11**, 605 (1999).

金属フェルミ準位と有機層の最高占有・最低非占有(HOMO・LUMO) 準位の並び



S. Y. and Y. Morikawa, J. Chem. Phys. **128**, 244704 (2008).



- 結晶構造・分子配置とバンド構造の関係

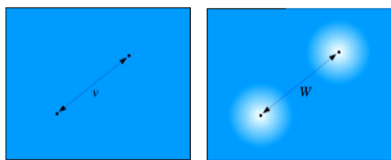
- S. Y., K. Yamauchi, T. Inaoka, T. Oguchi, and I. Hamada, Phys. Rev. B **90**, 245141 (2014)
- S. Y., K. Okuma, T. Inaoka, and I. Hamada, J. Electron. Spectrosc. Relat. Phenom. **204**, 159 (2015).
- S. Y. and I. Hamada, J. Appl. Phys. **121**, 045501 (2017).
- S. Y. and I. Hamada, A Chapter in *Theoretical Chemistry for Advanced Nanomaterials - Functional Analysis by Computation and Experiment* (Springer Nature, October 2019).

本研究の目的:

有機-金属界面での準位接続の予測の精密化のためにGW近似を適用できるように、プログラムを大規模並列計算向けに高度化。

2. 理論

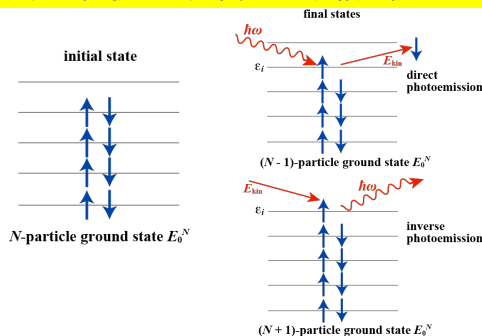
GW近似: 独立粒子模型・平均場近似に対し固体内のクーロン相互作用の遮蔽の効果を取り込む。



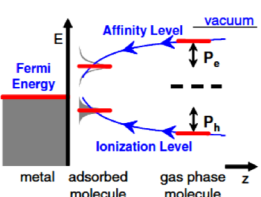
自己エネルギー Σ
 $\Sigma \approx GW$
G: 1体グリーン関数

「裸」のクーロン相互作用 v 遮蔽相互作用 W

光電子分光の実験での、準粒子の伝播に物理的に対応



有機層と電極金属の界面での準位接続の再現



J. B. Neaton et al., Phys. Rev. Lett/ **97**, 216405 (2006).

- 有機層のHOMO-LUMOバンドギャップ

- 表面付近での鏡像ポテンシャルの効果

$\sim 1/4|z - z_0|$

3. 計算方法、プログラムの現状、予定

GW space-time 法

- M. M. Rieger et al., Comput. Phys. Commun. **117**, 211 (1999).
- L. Steinbeck et al., Comput. Phys. Commun. **125**, 105 (2000).
- C. Freysoldt et al., Comput. Phys. Commun. **176**, 1 (2007).

$W(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega) = \varepsilon^{-1}(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega)v(\mathbf{G}, \mathbf{G}')$

$\Sigma(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; i\tau) = iG(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; i\tau)W(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; i\tau)$

$P(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; i\tau) = -2iG(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; i\tau)G(\mathbf{r}, \mathbf{r}'; -i\tau)$

畳み込み積分でなく、積を計算

$\tilde{\varepsilon}_k(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega) = \delta_{\mathbf{G}\mathbf{G}'} - \frac{4\pi}{|\mathbf{k} + \mathbf{G}||\mathbf{k} + \mathbf{G}'|} P_k(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega)$

$W_k(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega) = \frac{4\pi}{|\mathbf{k} + \mathbf{G}||\mathbf{k} + \mathbf{G}'|} \tilde{\varepsilon}_k^{-1}(\mathbf{G}, \mathbf{G}'; i\omega)$

- 高速フーリエ変換で $(\mathbf{r}, \mathbf{r}')$ と $(\mathbf{G}, \mathbf{G}')$; $(i\tau)$ と $(i\omega)$ を切替
- 非局所な複素数の量を計算。必要メモリが大きい。

前年度までの実装の状況

- 誘電行列 $\varepsilon_{\mathbf{G}\mathbf{G}'}$ の逆行列化を、ScaLapackを使わず、 \mathbf{k} と $i\omega$ のグリッドについて、ノードに分配
- ノード内で逆行列化計算をタスク並列化 (OpenMP)

Lapackのlibrary (ZHETRF/ZHETRI: Mathkeisan) の計測結果 (SX-ACE)。タスク並列化なし、またはタスク並列化 (2, 4スレッド) による20121次元の複素誘電行列のLU分解 (ZHETRF) および逆行列化 (ZHETRI) での経過時間。

	ZHETRF (秒)	ZHETRI (秒)
no OpenMP	181.3 (1.00)	361.1 (1.00)
OpenMP (2 threads)	99.2 (1.83)	234.5 (1.54)
OpenMP (4 threads)	57.5 (3.15)	194.9 (1.85)

- 表面などの計算のための効率的計算法の実装: クーロンカットオフ [S. Ismail-Beigi, Phys. Rev. B **73**, 233103 (2006)]

今年度の予定

- コードの総合的解析、全交換などの通信コストの軽減。
- 有機半導体の表面準位や、金属表面に物理吸着した分子の電子準位の再現を試みる。